

各 位

2004 年 12 月 20 日

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン 次世代研究棟 10号館建設を決定

日本ゼオン株式会社(社長:古河 直純)は、独創的技術の研究開発を強化・促進し、次世代事業の創出による企業の拡大・展開を促進するため、総合開発センターおよび隣接の川崎工場(神奈川県川崎市)の一部を再開発し、次世代技術を研究開発する新研究棟10号館の新設と環境関連付帯設備の建設を行うことを決定した。

投資額は新研究棟、研究設備、環境付帯設備投資を含め約100億円を計画している。

日本ゼオンは、かねてより新規事業の拡大を図るため高機能樹脂ゼオネックス、ゼオノア、精密成形のLCD用フィルム 先端半導体材料であるゼオマック等を開発、上市すると共に次世代事業創出のため研究開発の充実を図ってきたが、事業領域の拡大、研究内容の高度化等にともない従来の研究施設に加え、独創的技術で次世代事業を創出させる新研究棟の必要性が生じてきた。これまで、新研究棟の新設を新規立地も視野にいれ総合的に検討を進めていたが、このたび神奈川県の助成を受け、現在の総合開発センターに新研究棟10号館として新設することを決定した。

新研究棟 10号館は、IT関連先端材料、精密製品設計、精密加工製品、など独創性の高い次世代事業創出の研究施設であるため、コンピューターを駆使した解析機能、ナノオーダーでの構造設計、精密加工や精緻なマイクロ分析が可能な最新の研究機器を導入し、研究開発の環境も研究開発の外乱因子である振動の防止や空気中の汚染等を排除したクリーンな環境とするなど、高性能で最先端の研究施設とする。

日本ゼオンでは、すでに昨年度、全館クリーンルームの研究棟を総合開発センターに新設し、更に現在、高岡工場(富山県高岡市)に精密光学研究所を建設中であり、近々完成する予定である。

今回の新研究棟の新設により、独創的世界一技術で、次世代事業創出のための盤石な研究開発体制ができあがると考えている。

また、今回の新研究棟の建設にあわせ、隣接する川崎工場の排水、廃棄物、大気等の環境関連設備の増強と更新を実施し環境への配慮を強化し、研究所および工場が一体となり地域とより良い関係、共生を図っていく。

次世代研究棟 10号館は平成17年2月に着工、平成19年3月に完成する予定である。

以上

(新研究棟 10号館の概要)

所在地 : 神奈川県川崎市川崎区夜光1-2-1

延べ床面積 : 約 10,000m² (8階建て)

日本ゼオン株式会社
広報室
電話 03-3216-2747

